

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分  
 【発行日】平成26年12月18日 (2014.12.18)

【公開番号】特開2014-82130(P2014-82130A)  
 【公開日】平成26年5月8日 (2014.5.8)  
 【年通号数】公開・登録公報2014-023  
 【出願番号】特願2012-230115(P2012-230115)  
 【国際特許分類】

H 0 1 J 35/14 (2006.01)

H 0 1 J 35/18 (2006.01)

H 0 1 J 35/08 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 J 35/14

H 0 1 J 35/18

H 0 1 J 35/08 C

【手続補正書】  
 【提出日】平成26年11月4日 (2014.11.4)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】0 0 4 5  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【 0 0 4 5 】

また、ターゲット用薄膜 2 5 5 は、イオンビームスパッタのような薄膜堆積法で形成される。ホルダ部 2 5 1 の支持される側の端部も気密に接合されており、その内部にはキャップ 2 5 8 が設けられ、キャップ 2 5 8 の内部と外部との間で形成される流通路に水等の冷媒を循環できるよう構成されている。ダイヤモンド板 2 5 6 の厚さは、3 0 0  $\mu$ m ~ 8 0 0  $\mu$ m であることが好ましい。